

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成22年6月17日 (2010.6.17)

【公表番号】特表2009-538446(P2009-538446A)

【公表日】平成21年11月5日 (2009.11.5)

【年通号数】公開・登録公報2009-044

【出願番号】特願2009-512038(P2009-512038)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/029 (2006.01)

G 0 3 F 7/038 (2006.01)

G 0 3 F 7/004 (2006.01)

G 0 3 F 7/00 (2006.01)

G 0 3 F 7/027 (2006.01)

B 4 1 N 1/14 (2006.01)

【 F I 】

G 0 3 F 7/029

G 0 3 F 7/038 5 0 1

G 0 3 F 7/004 5 0 5

G 0 3 F 7/00 5 0 3

G 0 3 F 7/027

B 4 1 N 1/14

【手続補正書】

【提出日】平成22年4月20日 (2010.4.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ラジカル重合性成分、

画像形成輻射線に暴露すると、前記ラジカル重合性成分の重合を開始するのに十分なラジカルを生成することができるホウ酸ヨードニウム開始剤組成物、

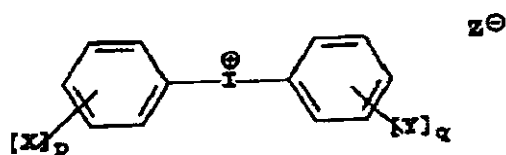
輻射線吸収化合物、及び

高分子バインダー

を含んでなる輻射線感光性組成物であって、

前記ホウ酸ヨードニウム開始剤組成物が、下記構造 ( I ) :

## 【化 1】

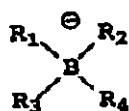


(I)

{ 上記式中、X 及び Y は独立して、ハロ、アルキル、アルキルオキシ、又はシクロアルキル基であり、又は 2 つ若しくは 3 つ以上の隣接する X 又は Y 基は、結合して、それぞれのフェニル環と縮合環を形成することができ、p 及び q は独立して、0 又は 1 ~ 5 の整数であるが、但し p 又は q が少なくとも 1 であり、且つ X 及び Y 置換基又は縮合環内の炭素原子の和が少なくとも 6 であることを条件とし、そして

Z<sup>-</sup> は、下記構造 (II) :

## 【化 2】



(II)

( 上記式中、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>、及び R<sub>4</sub> は独立して、アルキル、アリール、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、又はヘテロシクリル基であるか、又は、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>、及び R<sub>4</sub> のうちの 2 つ又は 3 つ以上が一緒に結合して、ホウ素原子と複素環を形成することができる )

によって表される有機アニオンである }

によって表されるホウ酸ジアリールヨードニウムを含む輻射線感光性組成物。

## 【請求項 2】

X 及び Y が独立してアルキル基であり、そして R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>、及び R<sub>4</sub> のうちの少なくとも 3 つが独立して、アリール基である請求項 1 に記載の組成物。

## 【請求項 3】

前記ホウ酸ヨードニウム開始剤組成物が、4 - オクチルオキシフェニルフェニルヨードニウムテトラフェニルボレート、[ 4 - [ ( 2 - ヒドロキシテトラデシル ) - オキシ ] フェニル ] フェニルヨードニウムテトラフェニルボレート、ビス ( 4 - t - ブチルフェニル ) ヨードニウムテトラフェニルボレート、4 - メチルフェニル - 4 ' - ヘキシルフェニルヨードニウムテトラフェニルボレート、4 - メチルフェニル - 4 ' - シクロヘキシルフェニルヨードニウムテトラフェニルボレート、ビス ( t - ブチルフェニル ) ヨードニウムテトラキス ( ペンタフルオロフェニル ) ボレート、4 - ヘキシルフェニル - フェニルヨードニウム - テトラフェニルボレート、4 - メチルフェニル - 4 ' - シクロヘキシルフェニルヨードニウム n - ブチルトリフェニルボレート、4 - シクロヘキシルフェニル - フェニル

ヨードニウムテトラフェニルボレート、2 - メチル - 4 - t - ブチルフェニル - 4 ' - メチルフェニルヨードニウムテトラフェニルボレート、4 - メチルフェニル - 4 ' - ペンチルフェニルヨードニウムテトラキス [ 3 , 5 - ビス (トリフルオロメチル) フェニル ] ボレート、4 - メトキシフェニル - 4 ' - シクロヘキシルフェニルヨードニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、4 - メトキシフェニル - 4 ' - ドデシルフェニルヨードニウムテトラキス (4 - フルオロフェニル) ボレート、ビス (ドデシルフェニル) ヨードニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、及びビス (4 - t - ブチルフェニル) ヨードニウムテトラキス (1 - イミダゾリル) ボレートのうちの1種又は2種以上を含む請求項1又は2に記載の組成物。

**【請求項4】**

前記高分子バインダーが、ペンダントビニル基又はペンダントN - カルバゾール部分を含んでなるポリマーであり、そして前記輻射線吸収化合物が赤外線感光性である請求項1 ~ 3 のいずれか一項に記載の組成物。

**【請求項5】**

請求項1 ~ 4 のいずれか一項に記載の組成物を含んでなる画像形成性層を基板上に有して成る画像形成性要素。

**【請求項6】**

機上現像可能である請求項5に記載の要素。

**【請求項7】**

A) 請求項5又は6に記載のネガ型画像形成性要素を像様露光すること、そして

B) 予熱工程なしに、前記画像形成性層の非露光領域だけを除去するために、前記像様露光された要素を現像すること  
を含んでなる画像形成された要素の製造方法。